

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke

MIKROELEKTRONIKA BMEVIEEAB01

Félvezető fizikai alapok

Dr. Bognár György, Dr. Poppe András

A szükséges fizikai ismeretek áttekintése

- Töltéshordozók a félvezetőben
- Áramok a félvezetőben
- Generáció, rekombináció, folytonossági egyenletek

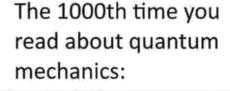
Ismerkedés a kvantummechanikával...

- Nem egyszeri alkalom... ②
- Folyamatos tanulmányozást és tanulást igényel...
- Life Long Learning

s p d

1

The first time you read about quantum mechanics:





Energiasávok a kristályos anyagban

- Alap kvantummechanikai ismeretek:
 - Pozitív atommag (proton, neutron) negatív elektronok
 - Elektronok diszkrét "pályákon"
 - Energiaminimumra törekvés elve: alacsonyabb héjak vannak betöltve
- Bohr atommodell
- **Pauli elv**: két e⁻ nem lehet azonos állapotban, egy elektronhéjon ellentétes spin (perdület) max. 2 e⁻
- Héjak között váltás, ha E-re tesznek szert
 Ez a többlet energia az aktuális állapot és a betöltetlen
 héjak közötti E-val egyezik meg
- Legvalószínűbb, hogy a legmagasabb betöltött állapotú szerez többlet energiát!



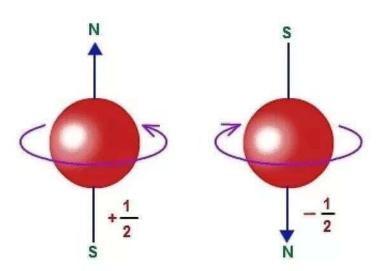
Diszkrét energia szintek



Energiasávok a kristályos anyagban

- Alap kvantummechanikai ismeretek:
 - **Pauli elv**: két e⁻ nem lehet azonos állapotban, egy elektronhéjon ellentétes spin (perdület) max. 2 e⁻

Electron spin explained: imagine a ball that's rotating, except it's not a ball and it's not rotating





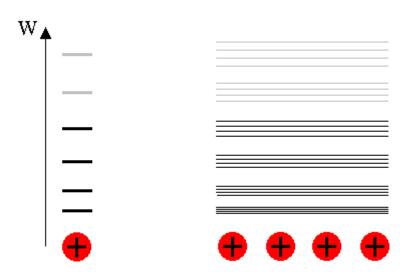


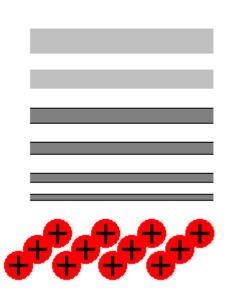
Energiasávok a kristályos anyagban

- Az egyedülálló atom energiaszintjei a kristályban sávokká (energy band) szélesednek
- Egyszerűsített sávszerkezetek (kristálytani iránytól független)

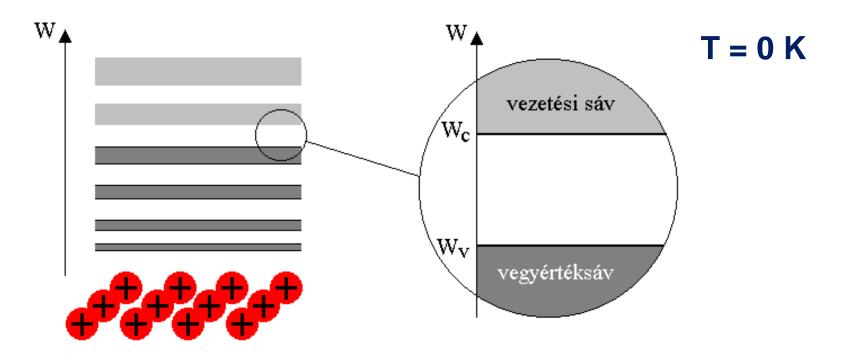
Diszkrét energia N db atom – N darab szintek: szintre hasadás:

Egykristályban szinte folytonos sávokká szélesednek:



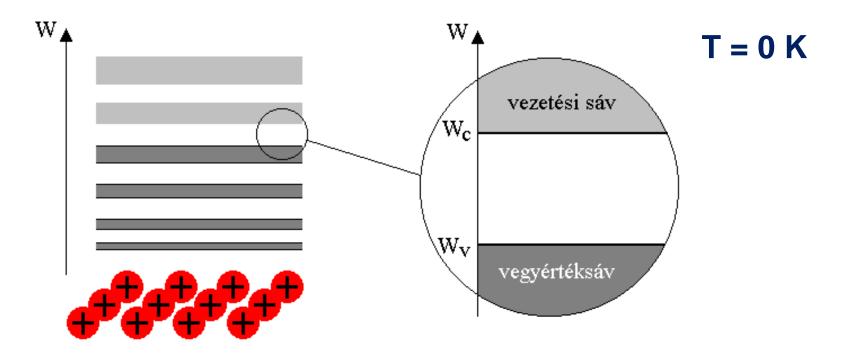


Vegyérték sáv, vezetési sáv



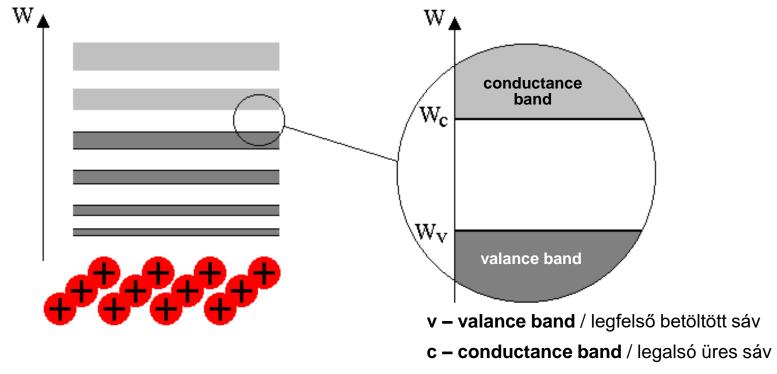
- Áramvezetési szempontból két sáv kiemelkedően fontos:
 - legmagasabb energia szintű, (majdnem) teli sáv (betöltött)
 - a legalacsonyabb energia szintű, (majdnem) üres sáv (betöltetlen)

Vegyérték sáv, vezetési sáv



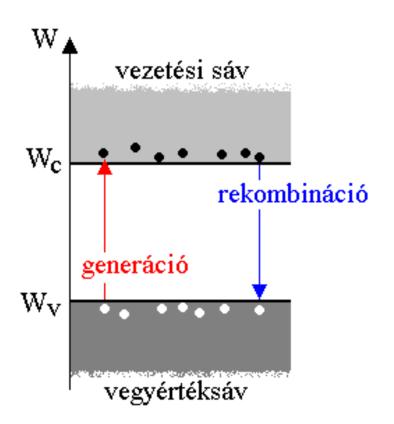
- Kémiai kötéseket a legkülső elektron héjon (legmagasabb energiaszintű betöltött sáv) található elektronok tudnak kialakítani
- Vegyértéksávban elektronok lokalizáltak!

Vegyérték sáv, vezetési sáv



■ **Vezetési sáv** – ezek az elektronok nem lokalizálódnak egyetlen atomhoz sem, szabadon tudnak mozogni, áramot tudnak vezetni

Elektronok és lyukak



- Hogy tudnak az elektronok mozogni a két sáv között?
- Generáció: e⁻ elhagyja a vegyértéksávot, vegyértéksávban e⁻ hiány jön létre. → Töltéshordozó pár generálódik
- Elektronok: a vezetési sáv alján
- Lyukak: a vegyértéksáv tetején

Elektron: negatív töltés, pozitív tömeg

Lyuk: pozitív töltés, pozitív tömeg



Elektronok és lyukak

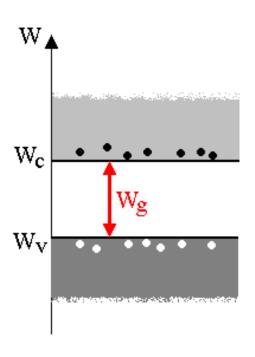
Generációhoz honnan nyerik az elektronok az E-t?

- Termikus gerjesztés
 - Rácsrezgés E-ja átadódik e⁻
- Foton gerjesztés
 - Olyan fény aminek legalább akkora az E-ja, mint W_g
 - $E = h \cdot v$

Vezetési sáv elektronsűrűségét a generáció és rekombináció dinamikus egyensúlya határozza meg

Vezetők és szigetelők

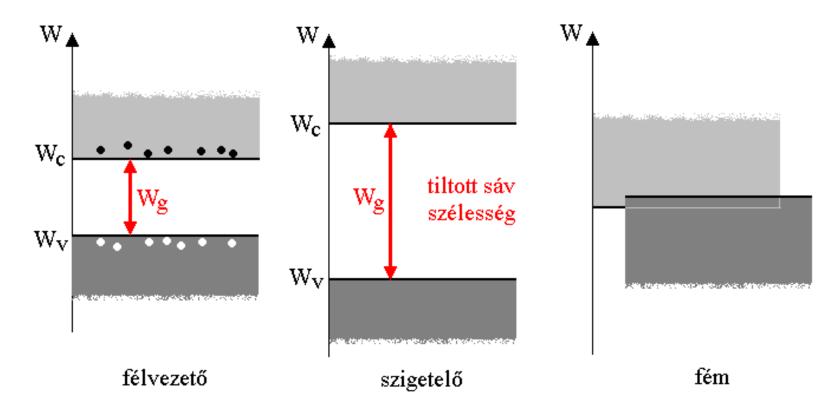




félvezető

Tiltott sávban elektron nem tartózkodik!

Vezetők és szigetelők



Szilíciumra: $W_g = 1.12 \text{ eV}$

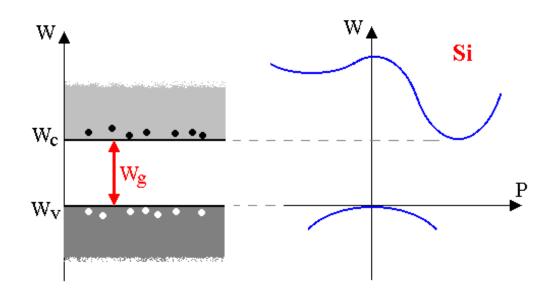
 SiO_2 -ra: $W_g = 9 \text{ eV}$

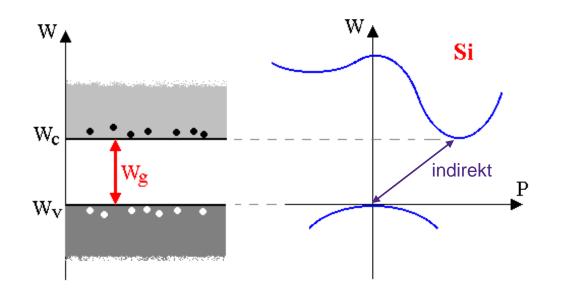
 $1 \text{ eV} = 0.16 \text{ aJ} = 0.16 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

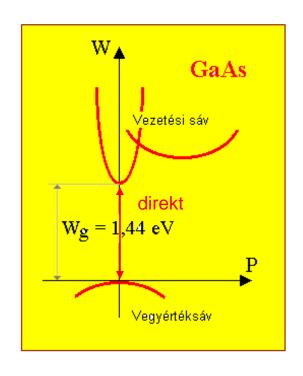
- Végtelen kiterjedésű kristályrácsban elektronok impulzusa és energiája között összefüggés!
- Impulzus (hullámszám) függvényében vizsgálva vezetési sáv alja és vegyérték sáv teteje
- Minimum (W_c) és maximum (W_v) pontok közötti táv W_g
- Egy helyen (impulzus)?

$$P = \frac{h}{2\pi} k$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot \nu}{c}$$



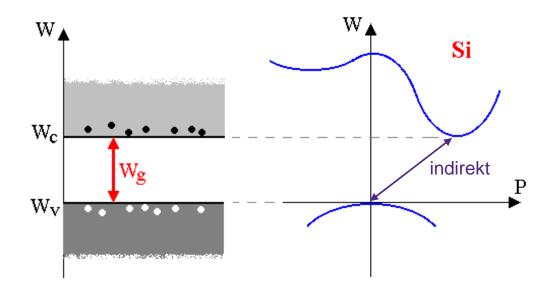




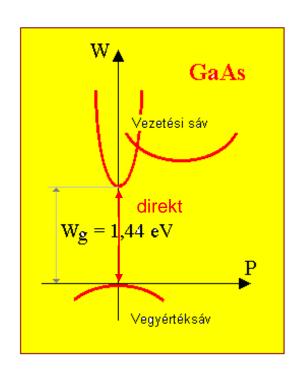
Indirekt sávú félvezető esetén energia- és impulzusmegmaradás törvényének is teljesülni kell!

GaAs: direkt sáv ⇒ opto-elektronika (pl. LED-ek)

Si: indirekt sáv



$$W = \frac{1}{2m} p^2 \longrightarrow W = \frac{1}{2m_{eff}} P^2$$

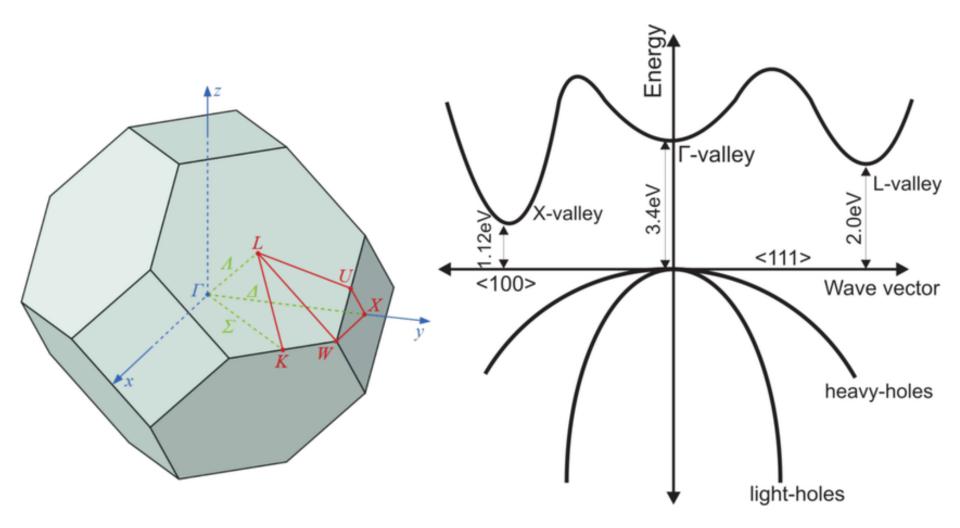


parabolikus sávszélközelítés

$$F = \frac{dP}{dt} \quad P = \frac{h}{2\pi} k$$

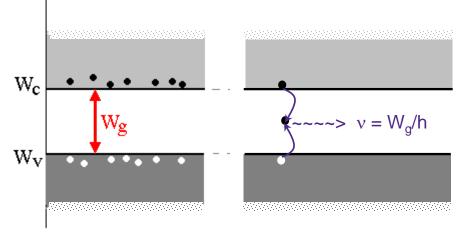
m_{eff} – effektív tömeg, kvantumfizikai összefüggések levezetésével elektronnak és lyuknak is! Nagysága a sávszél görbültségétől függ!

Szilícium részletes sávszerkezete

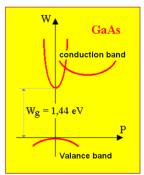


Generáció / rekombináció

Spontán folyamatok: termikus gerjesztés – ugrás a vezetési sávba w₄ / rekombináció: visszatérés a vegyérték sávba → equilibrium



Direkt rekombináció fényemisszióval jár(hat), lásd: LED-ek



$$v = \frac{W_g}{h}$$

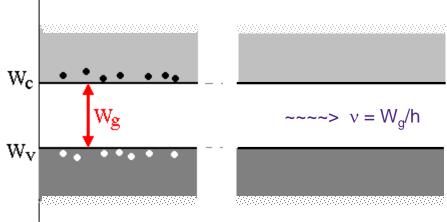
$$\lambda = \frac{c}{v}$$

Vörös lézerfény esetén W_g ≈ 1.5eV

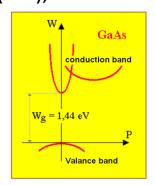
Indirekt **rekombináció** nem radiatív, mindig hődisszipációval jár (fonon – rácsrezgés)

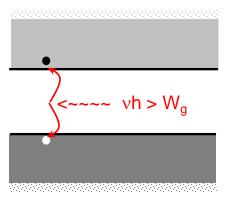
Generáció / rekombináció

Spontán folyamatok: termikus gerjesztés – ugrás a vezetési sávba w₄ / rekombináció: visszatérés a vegyérték sávba → equilibrium



Direkt rekombináció fényemisszióval jár(hat), lásd: LED-ek

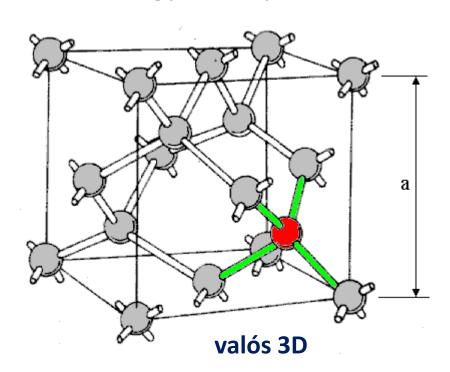




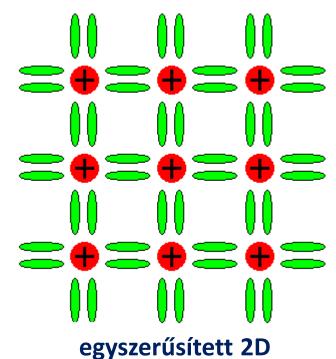
Fényelnyelés generációt okozhat – lásd: napelemek

A szilícium kristályszerkezete

■ N=14, 4 vegyérték, periódusos rendszer *IV*. oszlopa

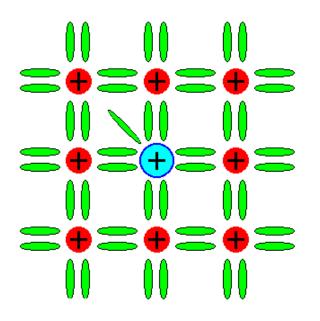


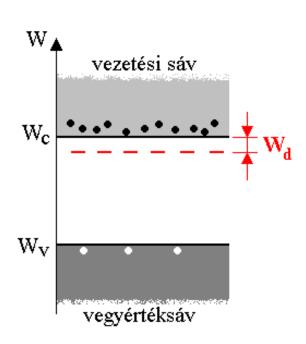
Adalékolatlan vagy <u>intrinsic</u> félvezető



- Gyémántrács, rácsállandó a=0.543 nm
- Minden atomnak 4 legközelebbi szomszédja van
- 10nm L esetén 20 db. Si rácsatom!

5 vegyértékű adalék: donor (As, P, Sb)



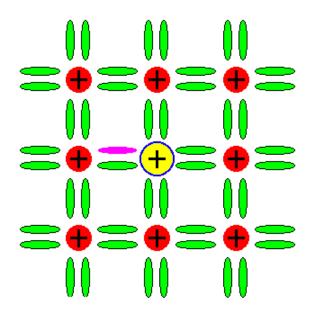


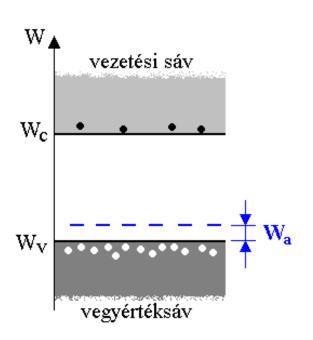
n-típusú félvezető

Elektron: <u>többségi</u> töltéshordozó

Lyuk: <u>kisebbségi</u> töltéshordozó

3 vegyértékű adalék: akceptor (B, Ga, In)





p-típusú félvezető

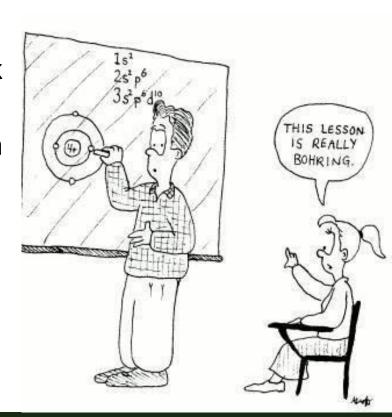
Elektron: <u>kisebbségi</u> töltéshordozó

Lyuk: <u>többségi</u> töltéshordozó

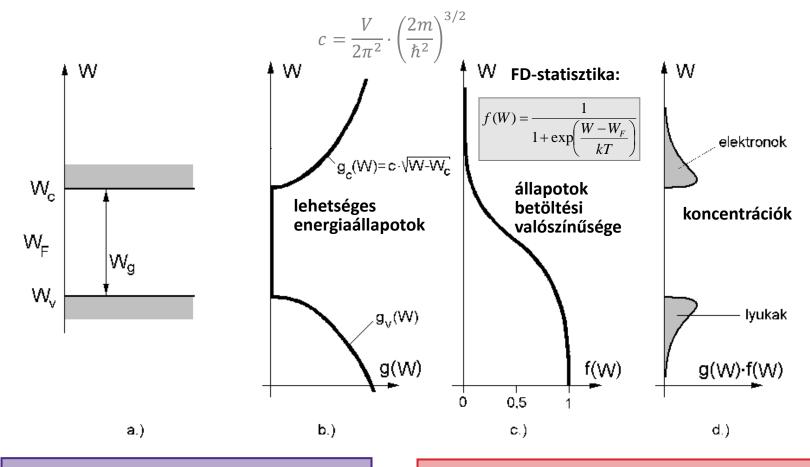
Hordozókoncentrációk számítása

Alapelvek:

- Továbbra is Bohr atommodel
- Pauli elv
- Legkisebb energiájú sávok először betöltve
- Fermi-Dirac statisztikában elektronok megkülönböztethetetlenek
- A betöltési valószínűség f(W), akkor a betöltetlenség valószínűsége 1-f(W)



Hordozókoncentrációk számítása



$$n = \int_{W_c}^{\infty} g_c(W) f(W) dW$$

$$p = \int_{0}^{W_{v}} g_{v}(W) \left[1 - f(W)\right] dW$$

Hordozókoncentrációk számítása

■ Az eredmény:

$$n = const T^{3/2} \exp\left(-\frac{W_c - W_F}{kT}\right)$$

$$p = const T^{3/2} \exp\left(-\frac{W_F - W_v}{kT}\right)$$

- Adalékolatlan félvezetőre n = p = n_i
 - az ilyent *intrinsic* anyagnak hívják

$$W_c - W_F = W_F - W_v$$

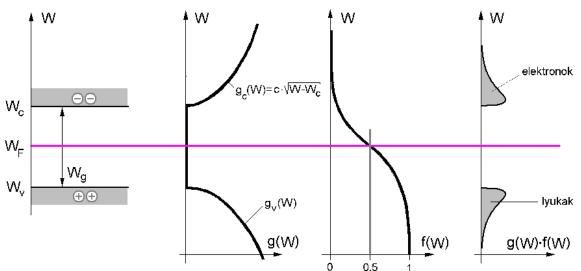
$$W_F = \frac{W_c + W_v}{2} = W_i$$

 $W_{\mathbf{F}} = W_{\mathbf{i}} - W_{\mathbf{v}}$

W_F: Fermi-szint

A Fermi-szint

- A Fermi-szint formális definíciója: az az energiaszint, ahol a lehetséges állapotok betöltöttségi valószínűsége 1/2:
- Ez intrinsic anyagnál a tiltott sáv közepén van: $f(W) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W W_F}{kT}\right)} = 0.5$



$$W_F = \frac{W_c + W_v}{2}$$

■ Ez az intrinsic Fermi-szint, W_i

Töltéshordozó sűrűségek

$$n = const T^{3/2} \exp\left(-\frac{W_c - W_F}{kT}\right) \qquad p = const T^{3/2} \exp\left(-\frac{W_F - W_V}{kT}\right)$$

$$p = const T^{3/2} \exp\left(-\frac{W_F - W_v}{kT}\right)$$

$$n \cdot p = const \cdot T^3 \exp(-W_g / kT)$$

Csak a hőmérséklettől függ, adalékolástól nem!

A "tömeghatás törvénye"

$$n \cdot p = n_i^2$$

Szilíciumra, 300 K hőmérsékleten

$$n_i = 10^{10} / cm^3$$

(10 töltéshordozó egy 0.01 mm élhosszúságú kockában)

Töltéshordozó sűrűségek

Példa

■ Si, T = 300 K, donor koncentráció $N_D = 10^{17} / cm^3$

■ Mennyi az elektron- és a lyuksűrűség értéke?

- Donor adalékolás \Rightarrow $n \approx N_D = \frac{10^{17} / cm^3}{}$
- Lyuk koncentráció: $p = n_i^2/n = 10^{20}/10^{17} = 10^{3}/cm^3$

Mekkora az adalék atomok relatív sűrűsége?

- 1 cm³ Si-ban 5·10²² atom van
- tehát, $10^{17}/5.10^{22} = 2.10^{-6}$
- Az adalékolt szilícium tisztasága 0.999998

Töltéshordozó sűrűségek

$$n = const T^{3/2} \exp\left(-\frac{W_c - W_F}{kT}\right)$$

$$n_i = const \, T^{3/2} \exp \left(-\frac{W_c - W_i}{kT}\right)$$

$$\frac{n}{n_i} = \exp\left(\frac{W_F - W_i}{kT}\right)$$

$$n = n_i \exp\left(\frac{W_F - W_i}{kT}\right)$$

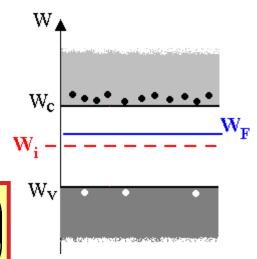
$$p = n_i \exp\left(-\frac{W_F - W_i}{kT}\right)$$

Csak egy alkalmas átrendezés...

Termikus energia

$$k \cdot T = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ VAs/K} \cdot 300 \text{ K}$$

$$= 4,14 \cdot 10^{-21} J = 0.026 eV$$



Adalékolt félvezetőben a Fermi-szint eltolódik az intrinsic Fermiszinthez képest!

Hőmérsékletfüggés

$$n_i^2 = n \cdot p = const \cdot T^3 \exp(-W_g / kT)$$

$$\frac{d}{dT}n_i^2 = n_i^2 \left(\frac{3}{T} + \frac{W_g}{kT^2}\right) \qquad \frac{dn_i^2}{n_i^2} = \left(3 + \frac{W_g}{kT}\right) \frac{dT}{T}$$

Ez mekkora Si-ra?

Példa

$$\frac{d n_i^2}{n_i^2} = \left(3 + \frac{1,12}{0,026}\right) \frac{dT}{300} \approx 0.15 dT \approx 15\% \text{ / °C}$$

Töltéshordozó-koncentráció hőmérsékletfüggése



Si, T = 300 K, a donor adalékok sűrűsége
$$N_D = 10^{17} / \text{cm}^3$$

 $n \cong N_D = 10^{17} / \text{cm}^3$
 $p = n_i^2 / n = 10^{20} / 10^{17} = 10^3 / \text{cm}^3$ $\Leftarrow n \cdot p = n_i^2$

Hogyan változik n és p, ha T 25 fokkal nő?

$$n \cong N_D = 10^{17} / cm^3 - valtozatlan$$

 $n_i^2 = 10^{20} \cdot 1.15^{25} = 33 \cdot 10^{20}$
 $\Rightarrow p = n_i^2 / n = 33 \cdot 10^{20} / 10^{17} = 3.3 \cdot 10^4 / cm^3$

Csak a kisebbségi hordozók sűrűsége nőtt!

 $\Delta T=16.5 \text{ °C} \rightarrow 10 \times$



Áramok a félvezetőben

- Sodródási áram (el. térerősség hatására)
- Diffúziós áram (sűrűség különbség hat.)

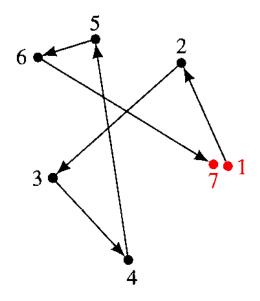
Amiről nem beszélünk:

- hőmérséklet különbség is indíthat áramot
- a mágneses erőtérnek is van befolyása
- töltésáramlás mellett energiaáramlás is van
- kombinált transzportjelenségek (HALL, Seebeck, Peltier)

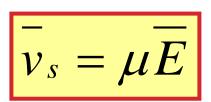


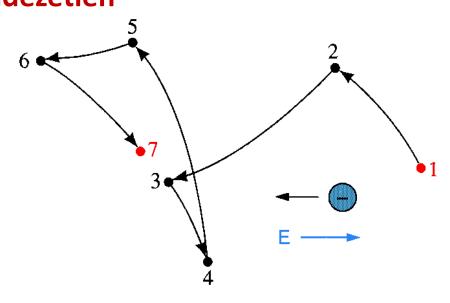
Sodródási áram (drift áram)

Az elektronok hőmozgása rendezetlen



Nincs térerősség





Van térerősség

$$\mu$$
 = mozgékonyság m²/Vs

Sodródási áram (drift áram)

$$\overline{J} =
ho \stackrel{-}{v} \quad {}_{ ext{v (átlag)sebesség}}$$

$$\overline{v}_s = \mu \overline{E}$$

$$\frac{\overline{J}_n = q \, n \, \mu_n \, \overline{E}}{\overline{J}_p = q \, p \, \mu_p \, \overline{E}} = q \left(n \, \mu_n + p \, \mu_p \right) \overline{E}$$

$$\overline{J} = \sigma_e \overline{E}$$

Differenciális
Ohm törvény

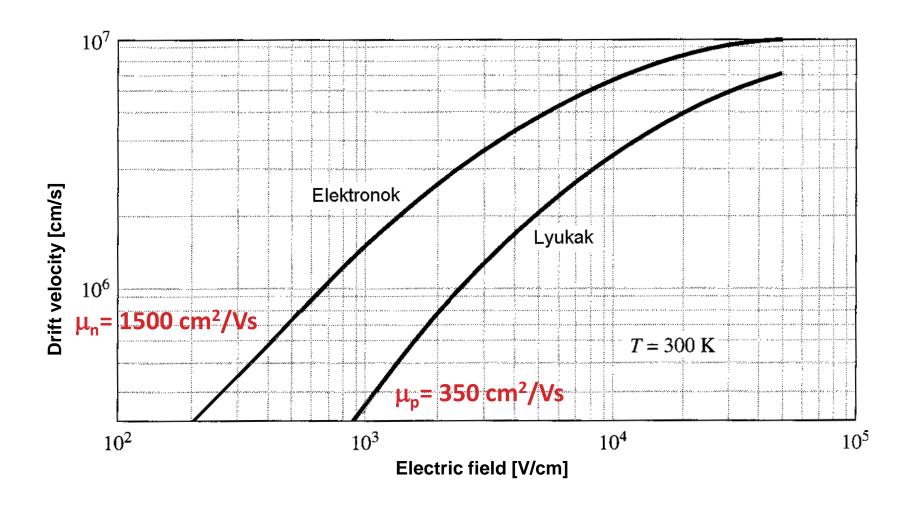
$$\rho_e = \frac{1}{\sigma_e} \longrightarrow \sigma_e = q \left(n \, \mu_n + p \, \mu_p \right)$$

Fajlagos ellenállás

A félvezetőanyag fajlagos vezetőképessége

A mozgékonyságról

Si

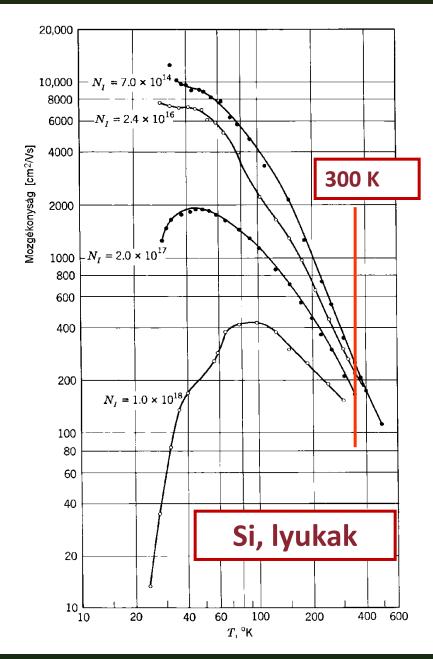




A mozgékonyságról

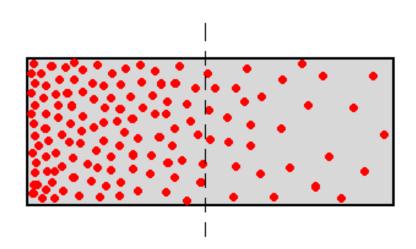
- Töltéshordozók mozgékonyságát az szóródások korlátozzák
- Növekvő adalékolással csökken
- Szobahőmérsékleten növekvő hőmérséklettel csökken

 $\mu \sim T^{-3/2}$



A diffúziós áram

- Két oldalt egyforma hőmozgás intenzitása
- Azonos valószínűség, hogy a szaggatott vonal kétoldaláról eátlépje a határvonalat
- DE sűrűség különbség van!
- Arányos a sűrűség gradienssel
- D = diffúziós állandó $[m^2/s]$



$$\overline{J_n} = q D_n \overline{\text{grad}} n$$

$$\overline{J_p} = -q D_p \overline{\text{grad}} p$$

A teljes áramsűrűség

$$\overline{J_n} = qn\mu_n \overline{E} + qD_n \overline{\text{grad}} n$$

$$\overline{J_p} = qp\mu_p \overline{E} - qD_p \overline{\text{grad}} p$$

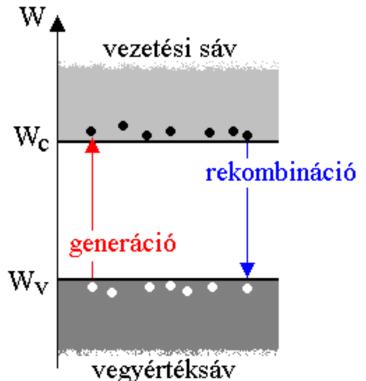
$$D = \frac{kT}{q}\mu$$
 Einstein összefüggés

$$U_T = \frac{kT}{q}\Big|_{T=300K} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} [\text{VAs/K}] \cdot 300[\text{K}]}{1,6 \cdot 10^{-19} [\text{As}]} \cong 0,026 \text{ V} = 26 \text{ mV}$$

Termikus feszültség



Generáció, rekombináció



- Élettartam: az az átlagos idő, amit egy elektron a vezetési sávban tölt
 - értékét szennyezők befolyásolják (rekombinációs centrumok, tiltott sávban megengedett állapotok jelenléte)

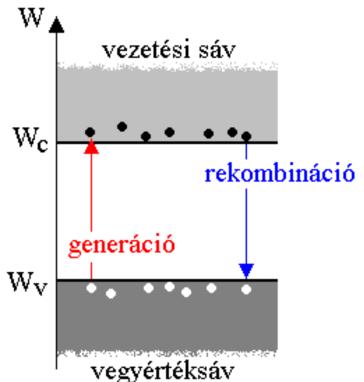
$$\tau_n$$
, τ_p 1 ns ... 1 μ s

- Egy e- élettartama τ_n , akkor dt idő alatti rekombináció vsz. dt/τ_n
- rekombinációs ráta: r [1/m³s]

Egységnyi idő alatt, egységnyi térfogaton rekombinálódott töltéshordozók száma

$$r_n = \frac{n \cdot dt}{\tau_n}$$
 egységnyi idő, egységnyi V $r_n = \frac{n}{\tau_n}$

Generáció, rekombináció



$$r_n = \frac{n}{\tau_n}$$
 $r_p = \frac{p}{\tau_p}$

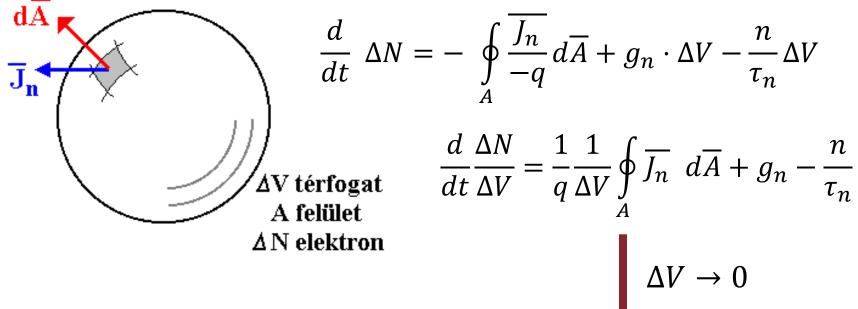
- Élettartam: az az átlagos idő, amit egy elektron a vezetési sávban tölt
 - értékét szennyezők befolyásolják (rekombinációs centrumok, tiltott sávban megengedett állapotok jelenléte)

$$\tau_n$$
, τ_p 1 ns ... 1 μ s

- *generációs ráta: g* [1/m³s]
- *rekombinációs ráta:* r [1/m³s]

$$g_n = r_n \Big|_{egyens\'ulyi} = \frac{n_0}{\tau_n}$$

Folytonossági egyenlet



Hogyan változik a töltéshordozók száma az időben?

Mikroelektronika BMEVIEEAB01

$$\frac{dn}{dt} = \frac{1}{q}\operatorname{div}(\overline{J_n}) + g_n - \frac{n}{\tau_n}$$

Folytonossági egyenlet

$$\frac{dn}{dt} = \frac{1}{q}\operatorname{div}(\overline{J_n}) + g_n - \frac{n}{\tau_n}$$

$$\overline{J_n} = qn\mu_n \overline{E} + qD_n \overline{\text{grad}} n$$



$$\left| \frac{dn}{dt} = \mu_n \operatorname{div}(n\overline{E}) + D_n \operatorname{div}\operatorname{grad} n + g_n - \frac{n}{\tau_n} \right|$$

$$\frac{dp}{dt} = -\mu_p \operatorname{div}(p\overline{E}) + D_p \operatorname{divgrad} p + g_p - \frac{p}{\tau_p}$$

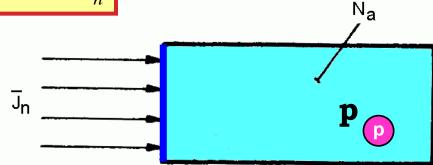


Példa a diffúziós egyenlet megoldására

$$\frac{dn}{dt} = \mu_n \operatorname{div}(n\overline{E}) + D_n \operatorname{div}\operatorname{grad} n + g_n - \frac{n}{\tau_n}$$

$$0 \qquad 0 \qquad d^2/dx^2$$

- Homogén p adalékolású szilícium tömb
- Állandó áramsűrűséggel elektronok injektálva
- Diffúzióval haladnak (E=0), miközben rekombinálódnak
- Stacioner állapot (dn/dt=0)



- Milyen a beinjektált kisebbségi töltéshordozók n(x) eloszlása?
- Átlagosan milyen mélységig hatolnak be, mielőtt rekombinálódnak?

Példa a diffúziós egyenlet megoldására

$$\frac{dn}{dt} = \mu_n \operatorname{div}(n\overline{E}) + D_n \operatorname{divgrad} n + g_n - \frac{n}{\tau_n}$$

$$0 \qquad 0 \qquad d^2/dx^2$$

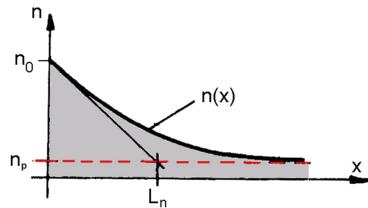
$$0 = D_n \frac{d^2n}{dx^2} + g_n - \frac{n}{\tau_n}$$

$$0 \qquad \int_{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{p}$$

$$0 = D_n \frac{d^2n}{dx^2} + \frac{n_p}{\tau_n} - \frac{n}{\tau_n}$$
Termikus egyensúlynak megfelelő generációs ráta modellje a p típusú anyagban

$$n(x) = n_p + (n_0 - n_p) \exp(-x/\sqrt{D_n \tau_n})$$

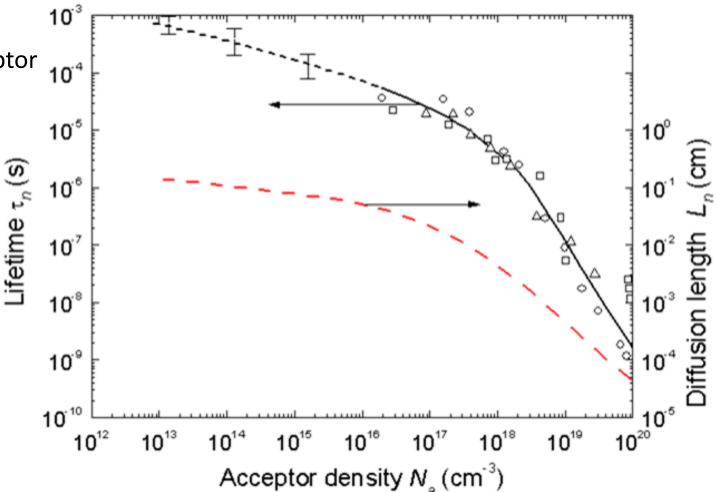
$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$
 diffúziós hossz



Diffúziós hossz és adalékolás összefüggése

 Elektron kisebbségi töltéshordozó

 p adalékolású tömbben (Acceptor density)



 $N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

■ $\tau_n = 0.1 \text{ msec}$

• $L_n = 200 \text{ um}$

Tyagi, M. S. and R. Van Overstraeten, Solid State Electronics 26, 6 (1983) 577-598

Ugyanez felírható lyukakra is:

$$\frac{dp}{dt} = -\mu_p \operatorname{div}(p\overline{E}) + D_p \operatorname{divgrad} p + g_p - \frac{p}{\tau_p}$$



$$L_p = \sqrt{D_p \cdot \tau_p}$$

Mikroelektronika BMEVIEEAB01